

Family list

1 application(s) for: **JP6088233**

1 VACUUM DEPOSITING DEVICE

Inventor: KAWASAKI YOSHINORI ;
SHIRAKAWA TADAHIDE (+1)

Applicant: ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND

EC:

IPC: *C23C14/56; C23C14/24; C23C14/56; (+2)*

Publication info: **JP6088233 (A)** — 1994-03-29
JP3257056 (B2) — 2002-02-18

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19) Japanese Patent Office (JP)

(12) Publication of Laid-Open Patent Application (A)

(11) Publication Number of Patent Application:

Japanese Patent Laid-Open Publication No.Hei6-88233

(43) Date of Publication Application: March 29, 1994(Heisei 6)

(51) Int.Cl.⁵, C23C 14/56

Identification Mark

JPO file number: 8520-4K

FI

Request for Examination: Not requested

Number of Claims: 2

Total 4 pages

(21) Application Number:

Japanese Patent Application No.H4-237206

(22) Date of Filing: September 4, 1992(Heisei 4)

(71) Applicant:000000099

Ishikawajima Harima Heavy Ind Co.,Ltd.

2-2-1, Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo

(72) Inventor: Yoshinori Kawasaki

c/o Ishikawajima Harima Heavy Ind Co.,Ltd.

Higashi 2 Technical Center

3-1-15, Toyosu, Koto-ku, Tokyo

(72) Inventor: Tadahide Shirakawa

c/o Ishikawajima Harima Heavy Ind Co.,Ltd.

Higashi 2 Technical Center

3-1-15, Toyosu, Koto-ku, Tokyo

(74) Agent: Patent Attorney Nobuo Kinuya

Continued to the last page

(54) [Title of the Invention] Vacuum Evaporation Device

(57) [Abstract]

[Object] To provide a vacuum evaporation device without exposing a vacuum vessel to the air in maintenance, and exchanging an evaporation crucible, further whose downtime is short.

[Constitution]

It is characterized by having a preparation chamber 16 which is provided in an evaporation chamber 10 through a vacuum shutoff valve 15 and which has a heating means 19 to heat an exchange evaporation crucible 13 in a vacuum evaporation device in which vacuum evaporation is done by allowing a thin-plate-like material to be evaporated to continuously pass through an evaporation chamber 10 containing an evaporation crucible.

[Scope of claims]

[Claim 1] A vacuum evaporation device characterized by having a preparation chamber which is provided in a vacuum vessel through a vacuum shutoff valve and which comprises a heating means to heat an exchange evaporation crucible in a vacuum evaporation device in which vacuum-evaporation is done by allowing a thin-plate like material to be evaporated to continuously pass through a vacuum vessel containing an evaporation crucible.

[Claim 2] The vacuum evaporation device according to claim 1, characterized by comprising an extraction chamber which is provided in the vacuum vessel by another vacuum shutoff valve and which contains a used crucible.

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial field of the Invention] The present invention relates to a vacuum evaporation device in which vacuum evaporation is done by allowing a thin-plate like material to be evaporated to continuously pass through a vacuum vessel containing an evaporation crucible.

[0002]

[Prior art] A vacuum evaporation device is given as a device for forming a film continuously on a thin-plate-like material to be evaporated using an evaporation material made of metal.

[0003] Fig.3 is an external perspective view showing this kind of conventional vacuum evaporation device (manufactured by LEYBOLD (Germany)), and Fig.4 is a schematic view showing its major part.

[0004] In Fig.3 and Fig.4, a vacuum evaporation device comprises an evaporation chamber as a vacuum vessel (hereinafter referred to as an evaporation chamber) 1, a vacuum pump 2 for evacuating air from the evaporation chamber 1 which is connected to the evaporation chamber 1, a fountain roll 4 which is wrapped with a thin-plate-like material to be evaporated 3 for forming a film continuously which is disposed in the evaporation chamber 1, an evaporation crucible 5 (hereinafter referred to as a crucible), which is provided in the evaporation chamber 1 and which contains an evaporation material to be a film, an electron gun 6 for forming a film of an evaporation material on

a material to be evaporated which is pulled out from the fountain roll 4, which is installed in the evaporation chamber 1 and by which is an evaporation material is irradiated with electron beam to be evaporated, a wind roll 7 for rolling up the material to be evaporated 3 which has been already evaporated, and an exchange chamber of a crucible 8 for exchanging a used crucible 5a which is provided in the evaporation chamber 1, so that it can be inserted and taken out.

[0005]

[Problem to be solved by the invention] However, the conventional vacuum evaporation device has the following problems.

[0006] (1) When a crucible in use is exchanged or done maintenance on due to breakage or defect, the evaporation chamber needs to be exposed to the air. Therefore, when a device dimensions becomes large, a long time at re-evacuation air i.e. at rest is required.

[0007] (2) In case that a material of a crucible is ceramic or graphite, and it is put in the evaporation chamber directly, it takes a long time to evacuate gas because a new crucible absorbs much gas.

[0008] (3) In the case that a new crucible is heated outside an evaporation chamber to evacuate gas, it absorbs gas in the air before it is introduced in the evaporation chamber after evacuating gas.

[0009] (4) Since there aren't a heating means for heating a crucible or a device for supplying an evaporation material in the exchange chamber of crucible, it is not possible to evacuate gas or to melt it at the first step.

[0010] An object of the invention is to solve the problems and to provide a vacuum evaporation device which dose not need to expose a vacuum vessel to the air in the maintenance or exchanging an evaporation crucible, and further whose downtime is

short.

[0011]

[Means to solve the problem]

To accomplish the purpose, according to the present invention there is provided a preparation chamber which is provided in a vacuum vessel through a vacuum shutoff valve and which has a heating means to heat an exchange evaporation crucible in a vacuum evaporation device in which vacuum-evaporation is done by allowing a thin-plate like material to be evaporated to continuously pass through a vacuum vessel containing an evaporation crucible.

[0012] In addition, a vacuum evaporation device of the present invention is provided in a vacuum vessel through a vacuum shutoff valve and is provided with an extraction chamber for containing a used crucible.

[0013]

[Operation] According to the above structure, since a preparation chamber is provided through a vacuum shutoff valve in a vacuum vessel, vacuum of the vacuum vessel is maintained even if the preparation chamber is exposed to the air. Also, it is possible to evacuate gas of a crucible for exchange simultaneously during a vacuum evaporation process, and it is possible to use a crucible for exchange without making a pause of a vacuum evaporation device to evacuate gas because the preparation chamber has a heating means.

[0014]

[Embodiment] Hereinafter, an embodiment is explained with reference to the attached drawings.

[0015] Fig.1 is a plane schematic view showing a major part in an embodiment of a

vacuum evaporation device.

[0016] In the same figure, the vacuum evaporation device includes an evaporation chamber 10 as a vacuum vessel, a vacuum pump 11 for evacuating air from the evaporation chamber 10 which is connected to this evaporation chamber 10, a thin-plate-like material to be evaporated 12 for forming a film that passes through the evaporation chamber 10 continuously, an exchange crucible 13 which is provided in the evaporation chamber 10 and contains an evaporation material to form a film on this thin-plate-like material to be evaporated 12, an electron gun 14 which is installed in the evaporation chamber 10 and by which an evaporation material is irradiated with electron beam to be evaporated to form a film of an evaporation material on the thin-plate-like material to be evaporated 12, a vacuum shutoff valve 15 which is put at a side of the evaporation chamber 10, and can open or shut off the evaporation chamber 15, a preparation chamber 16 which is installed in this vacuum shutoff valve 15 and which contains the crucible 13 for exchange and a used crucible 13a, a vacuum pump 17 which is connected to the preparation chamber 16 and evacuate air from the preparation chamber 16, a material supply device 18 which is provided in the preparation chamber 16 and supplies an evaporation material into the exchange crucible 13, and a heating means 19 which is provided in the preparation chamber 16 and heats the exchange crucible 13.

[0017] In the preparation chamber 16, an inserting door to introduce the exchange crucible 13 and a extract door to take out the used crucible 13a are provided (both are not shown), generally these inserting door and taking door are closed.

[0018] A vacuum shutoff valve 15 blocks between the evaporation chamber 10 and the preparation chamber 16 during vacuum evaporation operations, or in inserting the

exchange crucible 13 in a preparation chamber 16, taking out the used crucible 13a from the preparation chamber 16, heating an exchange crucible 13 to evacuate gas, and opens between the evaporation chamber 10 and the preparation chamber 16 in transferring the exchange crucible 13 from the preparation chamber 16 into the evaporation chamber 10, or transferring a used crucible 13a from the evaporation chamber 10 into the preparation chamber 16.

[0019] Transferring of each crucible 13, 13a between the evaporation chamber 10 and the preparation chamber 16 is performed by an unshown transfer mechanism.

[0020] As to a material to be evaporated 12, a film, a tape or the like made of thin steel plate, a metal or a resin is used to be supplied into the evaporation chamber 16 continuously.

[0021] Here, the reason why evacuating gas of the exchange crucible 13 is performed is explained.

[0022] For example, in the case of using Al(aluminum) as an evaporation material, when a melting point of Al is about 660 °C, and an evaporating temperature is about 1500 °C, a temperature of 1000 °C or more is preferable for evacuating gas from the crucible 13. Therefore, when evacuating gas of the crucible 13, if an evaporation material is contained in the crucible 13, this evaporation material is melted and thus the impurities like water is mixed there into. To remove the impurities, evacuating gas is performed by heating the empty crucible 13.

[0023] Next, operation of embodiments is described.

[0024] In the case that a crucible in use 13b is exchanged or repaired, it is necessary to insert the exchange crucible 13 in the preparation chamber 16 with a vacuum shutoff valve 15 shut off, and to evacuate gas in advance by heating this crucible 13 with a

heating means at the same time as vacuuming it with a vacuum pump 17. An evaporation material which is required for melting it at the first stage is supplied from a material supply device into the exchange crucible 13 which has been already evacuated gas. After supplying an evaporation material to the exchange crucible 13, the exchange crucible 13 is transferred from the preparation chamber 16 to the evaporation chamber 10 in the direction of an arrow at the same time as that a vacuum shutoff valve 15 is opened and a used crucible 13a is transferred from the evaporation chamber 10 to the preparation chamber 16 in the direction of an arrow. After transferring both crucibles 13, 13a, a vacuum shutoff valve 15 is blocked and an evaporation process is performed while transporting continuously a material to be evaporated 12 at the same time as operating a vacuum pump 11 and the electron gun 14 and the like.

[0025] The preparation chamber 16 is provided through the vacuum shutoff valve 15 in the evaporation chamber 10. Therefore, even if the preparation chamber 16 is exposed to the air and the exchange crucible 13 is introduced or the used crucible 13a is taken out, the vacuum state in the evaporation chamber 10 is maintained. In addition, it is possible to evacuate gas of the exchange crucible 13 at the same time during a vacuum evaporation operation since the preparation chamber 16 includes a heating means 19. It is possible to use the exchange crucible 13 in the evaporation chamber 10 in a short time without making a pause to evacuate gas from a vacuum evaporation device as a conventional one.

[0026] Fig.2 is a plan schematic view showing another embodiment of a vacuum evaporation device of the present invention.

[0027] In the above-mentioned figure, the difference from the embodiment shown in Fig.1 is that an extraction chamber 23 which includes a used crucible 22 is provided by a

vacuum shutoff valve 2 in an evaporation chamber 20.

[0028] When exchanging a crucible 22a in use in this vacuum evaporation device, a crucible for exchange 22b is inserted in a preparation chamber 25 with a vacuum shutoff valve 24 blocked, and evacuating gas of a crucible for exchange 22b is performed by operating a heating means 27 at the same time as vacuuming by operating a vacuum pump 26. Thus, a required amount of evaporation material is supplied in a crucible 22b in which evacuating gas is finished from a material supply device 28. After that a vacuum shutoff valve 21 is opened and a used crucible 22 is transferred in the direction of an arrow from the evaporation chamber 20 to the extraction chamber 23, the used crucible 22 is transferred to the extraction chamber 23, then the vacuum shutoff valve 21 is blocked and a exchange crucible 22b is transferred in the direction of an arrow from the preparation chamber 25 to the evaporation chamber 20 with opened a vacuum shutoff valve. After the exchange crucible 22b is transferred into the evaporation chamber 20, an evaporation process is started by operating a vacuum pump 29 and an electron gun 30 and the like. At this time, evacuating gas in the extraction chamber 23 is performed by operating a vacuum pump 31.

[0029] According to the present embodiment as mentioned above, since the preparation chamber 16 is provided in the evaporation chamber 10 through the vacuum shutoff valve 15, the vacuum state in the evaporation chamber 10 is maintained even if the preparation chamber 16 is exposed to the air. In addition, it is possible to evacuate gas of the exchange crucible 13 during a vacuum evaporation operation at the same time since the preparation chamber 16 includes a heating means 19. It is also possible to use the exchange crucible 13 in the evaporation chamber 10 without making a pause to evacuate gas from a vacuum evaporation device as a conventional one.

[0030] Note that the present embodiment, one is explained using a crucible but it is not limited to this, a liner may be also used. In addition, a supply device which supplies an evaporation material may be provided in an evaporation chamber.

[0031]

[Effect of the invention] Thus, after all the present invention offers the following great advantages.

[0032] (1) The time for exchanging a crucible can be drastically reduced.

[0033] (2) It becomes unnecessary to expose an evaporation chamber to the air for exchanging a crucible or maintenance, and the wasted time to evacuate gas can be cut.

[0034] (3) Since a preparation chamber includes a heating means, evacuating gas of a crucible can be performed before exchanging.

[0035] (4) Introducing an evaporation material in after heating a crucible can prevent impurities from being mixed in an evaporation material due to produced gas.

[Brief Description of Drawings]

[Fig.1] a plane schematic view showing a major part of one embodiment of a vacuum evaporation device according to the present invention.

[Fig.2] a plane schematic view of a vacuum evaporation device in another embodiment of the present invention.

[Fig.3] an external perspective view of a conventional vacuum evaporation device.

[Fig.4] a schematic view showing a major part of a vacuum evaporation device shown in Fig.3.

[Explanation of references]

10, 20 evaporation chamber
11, 17, 26, 29, 31 vacuum pump
12 material to be evaporated
13, 22b exchange crucible
13a, 22 used crucible
13b, 22a crucible in use
14, 30 electron gun
15, 21, 24 vacuum shutoff valve
16 preparation chamber
18, 28 material supply device
19, 27 heating means
23 extraction chamber

Continuation of front page

(72) Inventor Kiyoshi Nehashi

c/o Ishikawajima Harima Heavy Ind Co.,Ltd.

Higashi 2 Technical Center

3-1-15, Toyosu, Koto-ku, Tokyo

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-88233

(43)公開日 平成 6 年(1994) 3 月29日

(51)Int.Cl.⁵

C 2 3 C 14/56

識別記号

庁内整理番号

8520-4K

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平4-237206

(22)出願日 平成 4 年(1992) 9 月 4 日

(71)出願人 000000099

石川島播磨重工業株式会社

東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号

(72)発明者 川崎 義則

東京都江東区豊洲三丁目 1 番15号 石川島
播磨重工業株式会社東二テクニカルセンタ
ー内

(72)発明者 白川 忠秀

東京都江東区豊洲三丁目 1 番15号 石川島
播磨重工業株式会社東二テクニカルセンタ
ー内

(74)代理人 弁理士 絹谷 信雄

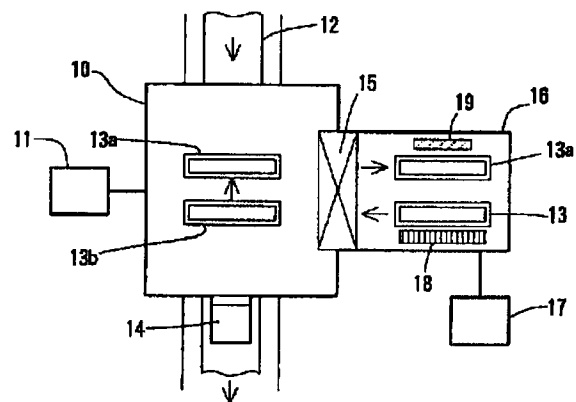
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 真空蒸着装置

(57)【要約】

【目的】 蒸発るつぼの交換、メンテナンス時に真空容器を大気開放することなく、しかも休止時間が短い真空蒸着装置を提供することにある。

【構成】 蒸発るつぼを収容した真空の蒸着室 10 内に薄板状の被蒸着部材を連続して通過させて真空蒸着する真空蒸着装置において、蒸着室 10 に真空遮断弁 15 を介して設けられ、交換用の蒸発るつぼ 13 を加熱する加熱手段 19 を有する準備室 16 を備えたことを特徴としている。



10 蒸着室
12 被蒸着部材
13a 使用済みのるつぼ
13b 使用中のるつぼ
14 電子銃
16 準備室
19 加熱手段

11, 17 真空ポンプ
13 交換用のるつぼ
15 真空遮断弁
18 材料供給装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 蒸発るつぼを収容した真空容器内に、薄板状の被蒸着部材を連続して通過させて真空蒸着する真空蒸着装置において、前記真空容器に、真空遮断弁を介して設けられ、交換用の蒸発るつぼを加熱する加熱手段を有する準備室を備えたことを特徴とする真空蒸着装置。

【請求項 2】 前記真空容器に、他の真空遮断弁を介して設けられ、使用済みの蒸発るつぼを収容する取出し室を備えたことを特徴とする請求項 1 に記載の真空蒸着装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、蒸発るつぼを収容した真空容器内に、薄板状の被蒸着部材を連続して通過させて真空蒸着する真空蒸着装置に関する。

【0002】

【従来の技術】金属からなる蒸着部材を、薄板状の被蒸着部材に連続的に被膜を形成する装置として真空蒸着装置がある。

【0003】図 3 は従来のこの種の真空蒸着装置（ライボルト社製（ドイツ））の外観斜視図であり、図 4 はその主要部の模式図である。

【0004】図 3 及び図 4 において、真空蒸着装置は、真空容器としての蒸着室（以下蒸着室という）1 と、蒸着室 1 に接続され蒸着室 1 を真空にするための真空ポンプ 2 と、蒸着室 1 内に配置され連続的に被膜を形成すべき薄板状の被蒸着部材 3 が巻き付けられた供給ロール 4 と、蒸着室 1 内に設けられ被膜となるべき蒸着材料を収容する蒸発るつぼ（以下るつぼという）5 と、蒸着室 1 に取り付けられ、蒸着材料に電子ビームを照射して蒸発させ、供給ロール 4 から引き出された被蒸着部材 3 に蒸着材料の被膜を形成するための電子銃 6 と、蒸着済みの被蒸着部材 3 を巻き取る巻き取りロール 7 と、蒸着室 1 に挿入取出し可能に設けられ使用済みのるつぼ 5 a を交換するためのるつぼ交換室 8 とで構成されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述した従来の真空蒸着装置には以下のような問題点がある。

【0006】(1) 使用中のるつぼが破損または不具合が生じて交換したり、メンテナンスを行ったりする場合に蒸着室を大気開放しなければならず、装置規模が大きくなると再排気時、すなわち休止時に長時間を要する。

【0007】(2) るつぼの材質がセラミック系やグラファイト系の場合、新品のるつぼはガスを多量に吸収しているため、そのまま直接蒸着室内に入れた場合、ガス出しに長時間を要する。

【0008】(3) 蒸着室の外部で新品のるつぼを加熱してガス出しを行う場合、ガス出しした後に蒸着室に挿入するまでの間に大気中のガスを吸収してしまう。

【0009】(4) るつぼ交換室には、るつぼを加熱する加熱手段や蒸着材料を供給する装置がないため、ガス出しや初期溶湯作りができない。

【0010】そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、蒸発るつぼの交換、メンテナンス時に真空容器を大気開放することなく、しかも休止時間が短い真空蒸着装置を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明は、蒸発るつぼを収容した真空容器内に、薄板状の被蒸着部材を連続して通過させて真空蒸着する真空蒸着装置において、真空容器に、真空遮断弁を介して設けられ、交換用の蒸発るつぼを加熱する加熱手段を有する準備室を備えたものである。

【0012】また、本発明の真空蒸着装置は、真空容器に、真空遮断弁を介して設けられ、使用済みの蒸発るつぼを収容する取出し室を備えたものである。

【0013】

【作用】上記構成によれば、真空容器に真空遮断弁を介して準備室が設けられているので、準備室を大気開放しても真空容器の真空状態が保持される。また、準備室が加熱手段を有するので、真空蒸着作業中に同時に交換用のるつぼのガス出しを行うことができ、真空蒸着装置をガス出しのために休止することなく交換用のるつぼを使用することができる。

【0014】

【実施例】以下、本発明の一実施例を添付図面に基いて詳述する。

【0015】図 1 は本発明の真空蒸着装置の一実施例の主要部の平面模式図である。

【0016】同図において真空蒸着装置は、真空容器としての蒸着室 10 と、この蒸着室 10 に接続され蒸着室 10 の真空引きを行う真空ポンプ 11 と、蒸着室 10 内を連続的に通過すると共に、被膜を形成すべき薄板状の被蒸着部材 12 と、蒸着室 10 内に設けられこの被蒸着部材 12 上に被膜を形成すべき蒸着材料を収容する交換用のるつぼ 13 と、蒸着室 10 に取り付けられ蒸着材料に電子ビームを照射して蒸発させ、被蒸着部材 12 に蒸着材料の被膜を形成するための電子銃 14 と、蒸着室 10 の側面に取り付けられ蒸着室 10 を開放または遮断することが可能な真空遮断弁 15 と、この真空遮断弁 15 に取り付けられ交換用のるつぼ 13 及び使用済みのるつぼ 13 a を収容する準備室 16 と、準備室 16 に接続され準備室 16 を真空にする真空ポンプ 17 と、準備室 16 に設けられ交換用のるつぼ 13 内に蒸発材料を供給する材料供給装置 18 と、準備室 16 内に設けられ交換用のるつぼ 13 を加熱する加熱手段 19 とで構成されている。

【0017】準備室 16 には、交換用のるつぼ 13 を挿入するための挿入扉と、使用済みのるつぼ 13 a を取出

すための取出し扉が設けられており（共に図示せず）、通常はこれらの挿入扉や取出し扉は閉じられている。

【0018】真空遮断弁15は、真空蒸着作業中や、準備室16内に交換用のるつぼ13を挿入したり、準備室16から使用済みのるつぼ13aを取出したり、交換用のるつぼ13をガス出しのために加熱したりする時には蒸着室10と準備室16との間を遮断し、準備室16内から蒸着室10内へ交換用のるつぼ13を移動したり、蒸着室10内から準備室16内へ使用済みのるつぼ13aを移動したりする時には蒸着室10と準備室16との間を開放するようになっている。

【0019】各るつぼ13、13aの、蒸着室10内と準備室16内との間の移動は、図示しない移動機構により行われるようになっている。

【0020】被蒸着部材12には薄板鋼板、金属や樹脂等の材料からなるフィルムやテープ等が用いられ、蒸着室10内に連続的に供給されるようになっている。

【0021】ここで、交換用のるつぼ13のガス出しを行う理由について述べる。

【0022】例えば、蒸着材料にA1（アルミニウム）を用いた場合、A1の融点は約660℃であるが、蒸発温度を約1500℃程度とすると、るつぼ13のガス出しには1000℃以上の温度が望ましい。したがってるつぼ13のガス出し時に、るつぼ13内に蒸着材料が収容されていると、この蒸着材料が溶解して水等の不純物が混入してしまう。そこで不純物を除去するためにるつぼ13を空のまま加熱してガス出しを行うのである。

【0023】次に実施例の作用を述べる。

【0024】使用中のるつぼ13bを交換または修理する場合、真空遮断弁15を遮断した状態で準備室16に交換用のるつぼ13を挿入し、真空ポンプ17で真空引きすると共に加熱手段19によってこのるつぼ13を加熱することによりあらかじめガス出しをしておく。ガス出し処理の済んだ交換用のるつぼ13内に、材料供給装置18から初期溶湯作りに必要な量だけ蒸着材料を供給する。交換用のるつぼ13に蒸着材料の供給した後真空遮断弁15を開放し、蒸着室10から準備室16へ使用済みのるつぼ13aを矢印方向に移動すると共に、準備室16から蒸着室10へ交換用のるつぼ13を矢印の方向に移動する。両るつぼ13、13aを移動した後真空遮断弁15を遮断し、真空ポンプ11、電子銃14等を作動すると共に、被蒸着部材12を連続的に搬送して蒸着プロセスを行う。

【0025】蒸着室10に真空遮断弁15を介して準備室16が設けられているので、準備室16を大気開放して交換用のるつぼ13を挿入したり、使用済みのるつぼ13aを取出しても蒸着室10内の真空状態が保持される。また、準備室16が加熱手段19を有するので、真空蒸着作業中に同時に交換用のるつぼ13のガス出しを行うことができ、従来のように真空蒸着装置をガス出し

のために休止することがなく、交換用のるつぼ13を短時間に蒸着室10内で使用することができる。

【0026】図2は本発明の真空蒸着装置の他の実施例の平面模式図である。

【0027】同図において図1に示した実施例との相違点は、蒸着室20に真空遮断弁21を介して使用済みのるつぼ22を収容する取出し室23が設けられた点である。

【0028】この真空蒸着装置内の使用中のるつぼ22aを交換する場合、前述と同様に、真空遮断弁24を遮断した状態で準備室25内に交換用のるつぼ22bを挿入し、真空ポンプ26を作動させて真空引きを行うと共に、加熱手段27を作動させて交換用のるつぼ22bのガス出しを行い、ガス出しが終了したるつぼ22b内に材料供給装置28より蒸発材料を必要量だけ供給しておく。真空遮断弁21を開放し、使用済みのるつぼ22を蒸着室20から取出し室23へ矢印の方向に移動し、取出し室23内に使用済みのるつぼ22が移動した後真空遮断弁21を遮断し、真空遮断弁24を開放して準備室25から蒸着室20へ交換用のるつぼ22bを矢印の方向に移動させる。交換用のるつぼ22bが蒸着室20内に移動した後、真空ポンプ29、電子銃30等を作動させて蒸着プロセスを開始する。このとき真空ポンプ31を作動して取出し室23内の真空引きを行う。

【0029】以上のように本実施例によれば、蒸着室10に真空遮断弁15を介して準備室16が設けられているので、準備室16を大気開放しても蒸着室10の真空状態が保持される。また、準備室16が加熱手段19を有するので、真空蒸着作業中に同時に交換用のるつぼ13のガス出しを行うことができ、真空蒸着装置をガス出しのために休止することなく交換用のるつぼ13を使用することができる。

【0030】尚、本実施例ではるつぼを用いて説明したが、これに限定されるものではなく、ライナーを用いてもよい。また、蒸発材料を供給する供給装置が蒸着室に設けられてもよい。

【0031】

【発明の効果】以上要するに本発明によれば、次のような優れた効果を発揮する。

【0032】(1) るつぼの交換時間が大幅に短縮できる。

【0033】(2) るつぼの交換、メンテナンスのために蒸着室を大気開放する必要がなくなり、無駄な真空排気時間がなくなる。

【0034】(3) 準備室が加熱手段を有しているので、交換前になるつぼのガス出しを行うことができる。

【0035】(4) るつぼ加熱後に蒸発材料を入れることによって、発生ガスによる蒸発材料への不純物混入を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の真空蒸着装置の一実施例の主要部の平面模式図である。

【図2】本発明の真空蒸着装置の他の実施例の平面模式図である。

【図3】従来の真空蒸着装置の外観斜視図である。

【図4】図3に示した真空蒸着装置の主要部の模式図である。

【符号の説明】

10、20 蒸着室

11、17、26、29、31 真空ポンプ

12 被蒸着部材

13、22b 交換用のるつぼ

13a、22 使用済みのるつぼ

13b、22a 使用中のるつぼ

14、30 電子銃

15、21、24 真空遮断弁

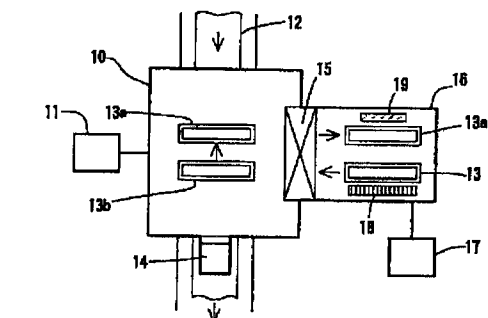
16 準備室

18、28 材料供給装置

19、27 加熱手段

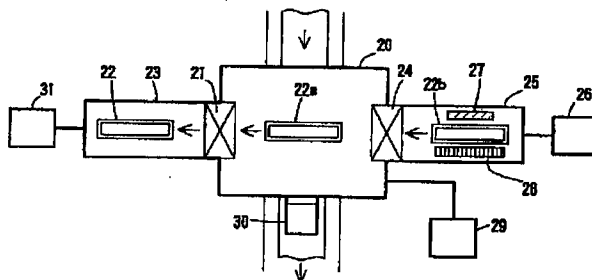
23 取出し室

【図1】

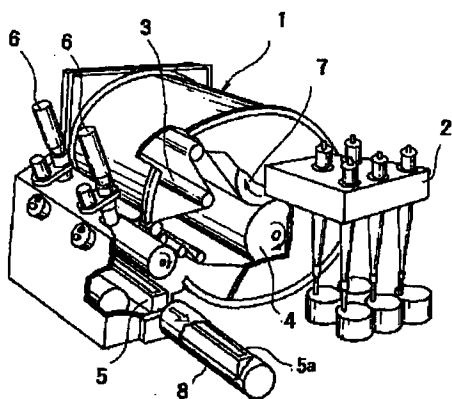


10 蒸着室
12 被蒸着部材
13a 使用済みのるつぼ
13b 使用中のるつぼ
14 電子銃
15 真空遮断弁
16 準備室
17 真空ポンプ
18 材料供給装置
19 加熱手段

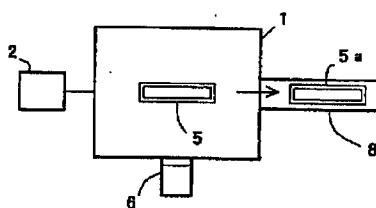
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 根橋 清

東京都江東区豊洲三丁目1番15号 石川島

播磨重工業株式会社東二テクニカルセンタ

ー内